

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年9月14日 (14.09.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/095859 A1

- (51) 国際特許分類:
G11B 7/26 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/304763
- (22) 国際出願日: 2006年3月10日 (10.03.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-069473 2005年3月11日 (11.03.2005) JP
特願2005-175629 2005年6月15日 (15.06.2005) JP
特願2005-175630 2005年6月15日 (15.06.2005) JP
特願2005-175631 2005年6月15日 (15.06.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): オリジン電気株式会社 (ORIGIN ELECTRIC COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1718555 東京都豊島区

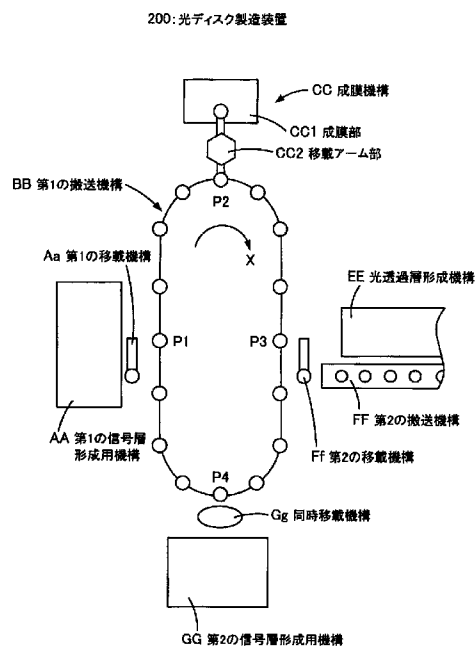
高田1丁目18番1号 Tokyo (JP). 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西村 博信 (NISHIMURA, Hironobu) [JP/JP]; 〒1718555 東京都豊島区高田1丁目18番1号 オリジン電気株式会社内 Tokyo (JP). 琴寄 正彦 (KOTOYORI, Masahiko) [JP/JP]; 〒1718555 東京都豊島区高田1丁目18番1号 オリジン電気株式会社内 Tokyo (JP). 中村 昌寛 (NAKAMURA, Masahiro) [JP/JP]; 〒1718555 東京都豊島区高田1丁目18番1号 オリジン電気株式会社内 Tokyo (JP). 久田 和也 (HISADA, Kazuya) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番

[続葉有]

(54) Title: OPTICAL DISC MANUFACTURING APPARATUS

(54) 発明の名称: 光ディスクの製造装置



200 OPTICAL DISC MANUFACTURING APPARATUS
CC FILM FORMING MECHANISM
CC1 FILM FORMING SECTION
CC2 PLACING ARM SECTION
BB FIRST TRANSFER MECHANISM
Aa FIRST PLACING MECHANISM
AA FIRST SIGNAL LAYER FORMING MECHANISM
GG SECOND SIGNAL LAYER FORMING MECHANISM
Gg SIMULTANEOUS PLACING MECHANISM
FF SECOND PLACING MECHANISM
FF SECOND TRANSFER MECHANISM
EE LIGHT TRANSMITTING LAYER FORMING MECHANISM

信号層形成用機構と、第1／2の反射膜上に光透過層を形成する光透過層形成機構と、上記機構の夫々に隣接しループ形状の基板の搬送を

(57) Abstract: An optical disc manufacturing apparatus is provided with a first signal layer forming mechanism for forming a first signal layer on a disc substrate (hereinafter referred to as substrate); a film forming mechanism for selectively forming a first reflection film on the first signal layer and forming a second reflection film on a second signal layer; a second signal layer forming mechanism for forming a second signal layer on the substrate whereupon the first reflection film is formed on the first signal layer; a light transmitting layer forming mechanism for forming a light transmitting layer on the first and second reflection films; a first transfer mechanism for transferring the loop-shaped substrate by being close to each of the mechanisms; a second transfer mechanism for transferring the substrate whereupon the first and second reflection films are formed on the first signal layer to the light transmitting layer forming mechanism by being close to the first transfer mechanism; a first placing mechanism for placing the substrate whereupon the first signal layer is formed on the first transfer mechanism; a second placing mechanism for selectively placing the substrate, which is transferred by the first transfer mechanism and has the first reflection film formed on the first signal layer, on the second transfer mechanism; and a third placing mechanism for placing the substrate, which is transferred by the first transfer mechanism and has the first reflection film formed on the first signal layer, on the second signal layer forming mechanism, and for placing the substrate, which is at the second signal layer forming mechanism and has the second signal layer formed, on the first transfer mechanism. The signal layers produce one layer or double layer optical disc.

(57) 要約: ディスク基板 (以下、基板) に第1の信号層を形成する第1の信号層形成用機構と、選択的に、第1の信号層上に第1の反射膜を成膜すると共に、第2の信号層上に第2の反射膜を成膜する成膜機構と、第1の信号層上に第1の反射膜が形成された基板に、第2の信号層を形成する第2の

[続葉有]



地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP). 大野 鋭二 (OHNO, Eiji) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP). 錦織 圭史 (NISHIKIORI, Keiji) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒1048453 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU,

SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

行う第 1 の搬送機構と、第 1 の搬送機構に隣接し、第 1 の信号層上に第 1 / 2 の反射膜が形成された基板を光透過層形成機構に搬送する第 2 の搬送機構と、第 1 の信号層の形成された基板を第 1 の搬送機構に移載する第 1 の移載機構と、第 1 の搬送機構によって搬送される第 1 の信号層上に第 1 / 2 の反射膜が形成された基板を選択的に第 2 の搬送機構に移載する第 2 の移載機構と、第 1 の搬送機構によって搬送される第 1 の信号層上に第 1 の反射膜が形成された基板を第 2 の信号層形成用機構に移載すると共に、第 2 の信号層形成用機構における第 2 の信号層が形成された基板を第 1 の搬送機構に移載する第 3 の移載機構とを備え、信号層が 1 又は 2 層の光ディスクを製造する光ディスク製造装置。